

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 1 区分

【発行日】平成25年11月14日 (2013.11.14)

【公開番号】特開2013-136032(P2013-136032A)

【公開日】平成25年7月11日 (2013.7.11)

【年通号数】公開・登録公報2013-037

【出願番号】特願2011-288798(P2011-288798)

【国際特許分類】

B 0 1 J 37/02 (2006.01)

B 0 1 J 23/78 (2006.01)

B 0 1 D 53/94 (2006.01)

【F I】

B 0 1 J 37/02 3 0 1 L

B 0 1 J 23/78 Z A B A

B 0 1 D 53/36 1 0 2 B

【手続補正書】

【提出日】平成25年10月1日 (2013.10.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基材と、該基材の表面に形成された触媒コート層と、を備える排ガス浄化用触媒であって、

前記触媒コート層は、前記基材表面に近い方を下層とし相対的に遠い方を上層とする上下層を有する積層構造に形成されており、

前記触媒コート層は、貴金属触媒として R h と P d とを備えており、

前記触媒コート層は、担体として酸素吸蔵能を有する O S C 材を備えており、

前記 R h は、前記触媒コート層の上層に配置されており、

前記 P d は、前記触媒コート層の上層と下層の双方に配置されており、

前記上層において、前記 R h を担持している担体は、 $Y_2O_3$  を含む  $ZrO_2$  複合酸化物からなり、

前記上層および下層において、前記 P d の少なくとも一部は前記 O S C 材に担持されており、

前記下層に配置された P d に対する前記上層に配置された P d の質量比が、0.01 以上 0.4 以下である、排ガス浄化用触媒。

【請求項 2】

前記上層および下層において、前記 P d の少なくとも一部を担持している O S C 材は、 $CeO_2$  または  $CeO_2 - ZrO_2$  複合酸化物からなる、請求項 1 に記載の排ガス浄化用触媒。

【請求項 3】

前記上層に配置された P d に対する R h の質量比が、1.25 ~ 5である、請求項 1 または 2 に記載の排ガス浄化用触媒。

【請求項 4】

前記下層に配置された P d に対する前記上層に配置された P d の質量比が、0.06 ~ 0.32である、請求項 1 ~ 3 の何れか一つに記載の排ガス浄化用触媒。

